EUROPEAN PATENT OFFICE

atent Abstracts of Japan

UBLICATION NUMBER

04076946

UBLICATION DATE

11-03-92

PPLICATION DATE

19-07-90

PPLICATION NUMBER

02189491

PPLICANT: FUJITSU LTD;

INVENTOR: YAMASHITA KOICHI;

INT.CL.

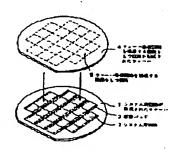
: H01L 27/00 H01L 25/00 H01L 25/04

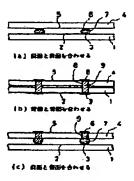
H01L 25/065 H01L 25/07 H01L 25/18

TITLE

: WAFER INTEGRATED CIRCUIT

DEVICE





ABSTRACT: PURPOSE: To facilitate the manufacture of a circuit and improve yield rate by forming a circuit for system and a circuit, which has the function of a wafer integrated circuit, on different wafers.

> CONSTITUTION: This comprises a wafer 1, where circuits 2 for system and connection pads 3 for the circuits for system are made, and a wafer 2, where circuits 5 which have the functions of constituting a wafer integrated circuit are made at the face opposed to the wafer 1. Through they are not shown in the circuits 5 which have the functions of constituting the wafer integrated circuit, connection pads 6 are provided at the positions conforming to the connection pads 3. The wafer 2, where the circuits 2 are formed, and the wafer 4, where the circuits are formed, are put on the other with the faces, where those circuits 2 and 5 are formed, opposed to each other, and both connection pads are connected by bumps 7 at the opposed faces.

COPYRIGHT: (C)1992,JPO&Japio

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

平4-76946 ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

Solnt. Cl. 5

27/00 25/00 25/04 H 01 L 25/065 25/07

25/18

識別記号 301

В

A

庁内整理番号 7514-4M 7638-4M

@公開 平成4年(1992)3月11日

7638-4M 7638-4M

25/04 H 01 L 25/08

z z

審査請求 未請求 請求項の数 4

(全6頁)

富士通株式会社

図発明の名称

ウエーハ集積回路装置

②特 頭 平2-189491

平2(1990)7月19日 @出

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

内

富士通株式会社 ⑪出 願

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

20代 理 弁理士 柏谷 外1名 人

1. 発明の名称

ウエーハ集積回路装置

2. 特許請求の範囲

(1). システム用回路(2)が形成されたウェー ハ(1)と、ウェーハ集積回路を構成する機能を もつ回路(5)が形成されたウエーハ(4)から なり、両ウエーハの該回路(2)、(5)が相互 に接続されることによりシステムが実現されてい ることを特徴とするウエーハ集積回路装置。

(2). システム用回路 (2) が形成されたウエー ハ(1)と、ウエーハ集積回路を構成する機能を もつ回路(5)が形成されたウエーハ(4)から なり、それらが前面と前面、背面と背面、あるい は、前面と背面を対向させて積層され、両ウエー ハの該回路(2)、(5)が相互に接続されるこ とによりシステムが実現されていることを特徴と するウエーハ集積回路装置。

(3). システム用回路(2)が形成されたウェー ハ(1)と、ウエーハ集積回路を構成する機能を

もつ回路が形成された複数のウエーハまたはチッ プ(4、10)が積層され、それらの回路間が相 互に接続されることによりシステムが実現されて いることを特徴とするウエーハ集積回路装置。

(4). システム用回路(2)が形成されたウェー ハ(1)と、配線のみが形成されているウエーハ (4)と、ウエーハ集積回路を構成する機能をも つ回路が形成されたチップまたはウエーハ (1 0)が積層され、それらの回路間が相互に接続さ れることによりシステムが実現されていることを 特徴とするウェーハ集積回路装置。

3. 発明の詳細な説明

(概要)

ウエーハ集積回路装置に関し、

汎用DRAMの大量生産によるコストメリット を生かして、組立コストをさらに低減したウェー ハ集積回路装置を提供することを目的とし、

システム用回路が形成されたウエーハと、ウェ 一ハ集積回路を構成する機能をもつ回路が形成さ れたウエーハからなり、両ウエーハの該回路が相

特閒平4-76946 (2)

互に接続されることによりシステムが実現される ように構成した。

また、システム用回路が形成されたウェーハと、ウェーハ集積回路を構成する機能をもつ回路が形成されたウェーハからなり、それらが前面と前面と背面と背面、あるいは、前面と背面を対向させて積層され、両ウェーハの移回路が相互に接続されることによりシステムが実現されるように構成し、

また、システム用回路が形成されたウエーハと、ウェーハ集積回路を構成する機能をもつ回路が形成された複数のウエーハまたはチップが積層され、それらの回路間が相互に接続されることによりシステムが実現されるように構成した。

そしてまた、システム用回路が形成されたウエーハと、配線のみが形成されているウエーハと、ウェーハ集積回路を構成する機能をもつ回路が形成されたチップまたはウエーハが積層され、それらの回路間が相互に接続されることによりシステムが実現されるように構成した。

中に欠陥をもつ領域が存在しても、欠陥をもたない集積回路、あるいは欠陥をもたない領域の素子を用いて、システム全体を正常に動作させるような欠陥教済技術を導入しなければならない。

(従来の技術)

近年、ウェーハ集和回路技術を用いて、汎用 D R A M コアにネットワーク形成用 ロジックを付加 することによってウェーハ上にネットワークを構成したウェーハ集 積回路装置が開発されている (雑誌「電子材料」1989年6月号p.71~75参照)。

これはDRAM本来の工程だけで製造できるために、例えば、レーザ光による配線の接続や断線、あるいは、フローティングゲートによる配線経路の選択等の欠陥迂回方法に比較して、量産性やコストの点で非常に有利である。

(発明が解決しようとする課題)

しかし、この方法は、1枚のウエーハにDRA Mとネットワーク形成用ロジックを形成していた ため、コストの面から汎用DRAMチップと比較 (産業上の利用分野)

本発明は、ウエーハ集積回路装置に関する。

従来の半導体集積回路装置においては、ウエーハ全体に一速の製造工程を施し、1 枚のウエーハ上に多数の素子からなる集積回路装置を複数個形成した後、集積回路装置ごとのチップとして切り難し、個々のチップを用いて半導体装置を形成するのが通例であった。

しかし、本発明の対象であるウエーハ集積回路 装置は、ウエーハ上に形成された複数の集積回路 装置を個々のチップに切り離さず、ウエーハ上に 形成した全チップ、あるいはその中の複数特定チップを用いて構成する大規模集積回路である。

このウェーハ集積回路装置は、チップごとに切り間す場合に比べて実装密度を高くでき、組立コストを低減できる等多くの利点を有しているが、半導体装置の製造工程における歩留りの現状からみて、ウェーハ上に形成された全ての集積回路装置が正常に動作する可能性はきわめて低いため、 欠陥をもつ集積回路装置あるいは集積回路装置の

した場合、特定用途向けのメモリチップを製造する場合と同様に、大量生産によるコストメリット を充分に実現することができない。

本発明は、この点に鑑み、汎用DRAMの大量 生産によるコストメリットを生かして、超立コストをさらに低減したウェーハ集積回路装置を提供 することを目的とする。

(課題を解決するための手段)

本発明にかかるウェーハ集積回路においては、システム用回路が形成されたウェーハと、ウェーハ集積回路を構成する機能をもつ回路が形成されたウェーハからなり、両ウェーハの該回路が相互に接続されることによりシステムが実現される構成を採用した。

また、システム用回路が形成されたウエーハと、 ウエーハ集種回路を構成する機能をもつ回路が形 成されたウエーハからなり、それらが前面と前面、 背面と背面、あるいは、前面と背面を対向させて 程階され、両ウエーハの第回路が相互に接続され ることによりシステムが実現される構成を採用し

特開平4-76946 (3)

た。

また、システム用回路が形成されたウエーハと、ウェーハ集積回路を構成する機能をもつ回路が形成された複数のウェーハまたはチップが積層され、それらの回路間が相互に接続されることによりシステムが実現される構成を採用した。

また、システム用回路が形成されたウエーハと、配線のみが形成されているウエーハと、ウェーハ集積回路を構成する機能をもつ回路が形成されたチップまたはウエーハが積層され、それらの回路間が相互に接続されることによりシステムが実現される構成を採用した。

(作用)

システム用回路とウエーハ集積回路の機能を持つ回路を別のウェーハ上に形成するため、それぞれのウェーハを製造するに際して、それぞれに最適の製造工程を選択することができ、システム用回路の大量生産によるコストメリットと、ウェーハ集積回路を構成する機能を有する回路の製造容易性を兼ね備えることができる。

このウェーハ集積回路装置において、システム 用回路 2 は、例えば、汎用 D R A M であり、ウエーハ集積回路を構成する機能をもつ回路 5 は、ウェーハ集積回路を構成する回路間の接続を決定するネットワーク用回路、使用するメモリチップにのみ電源を供給する機能を有するメモリチップ供給用パワースイッチ、配線等である。

そして、組立に際しては、両ウエーハ1、4が 位置合わせして積層され、それぞれの回路の接続 パッドが通宜接続されて、全体としてウエーハ集 権回路装置を構成する。

第2図(a)、(b)、(c)は本発明のウエーハ集積回路装置のウエーハ間の具体的な接続構造を示す断面図である。

この図中の符号は、7がパンプ、8が貫通孔、9が導体である他は、第1図において同符号を付して説明したものと同じものである。

第1具体例(第2図(a))

この例においては、システム用回路 2 が形成されたウェーハ 1 と、ウェーハ集積回路を構成する

また、これらのウェーハを積圧して配置し、その回路の間を相互に接続することによって回路間の接続距離を展短にすることができ、信号の伝播返延時間を最小に抑えることができる。

(実施例)

以下、本発明の実施例を図面に基づいて説明する。

(1)第1実施例

第1図は、本発明のウェーバ集積回路装置の第 1 実施例の構成図である。

第1図中の1はシステム用回路が形成されたウエーハ、2はシステム用回路、3はシステム用回路の接続パッド、4はウエーハ象積回路を構成する機能をもつ回路が形成されたウエーハ4のウエーハ1に対向では、5された、ウエーハ集積回路を構成する機能をもつ回路を構成する機能をもって、ウエーハ集積回路を構成する機能をもって、000路5には、図示されていいると整合する位置に接続パッド6が設けられている

機能をもつ回路 5 が形成されたウエーハ4が、それらの回路 2 、 5 が形成されている面(前面)どうしを対向させて積層し、その対向面において双方の接続用パッドをパンプ 7 によって接続することによってウエーハ集積回路装置が構成されてい

第2具体例(第2図(b))

この例においては、システム用回路2が形成されたウェーハーとウェーハ集積回路を構成する概能をもつ回路5が形成されたウェーハ4を、それらの回路2、5が形成されている面(させて積層し、ケーザ加工等によって双方の接続パッド3、6とウェーハ1、4を貫通する孔8を設け、この孔8の中に低融点金属や導電性樹脂等の導体9を埋め込んで両パッド間を接続することによって、ウェーハ集積回路装置が構成されている。

この場合、ウエーハ1、4に孔を設けることに 代えて、イオン注入等によってウエーハ中に不能 物を導入してウエーハの背面まで達する低抵抗の

特開平4-76946 (4)

事電路を形成し、この運電路が相対する部分で接続することによって、回路相互間を接続すること もできる。

第3具体例(第2図(c))

この例においては、システム用回路2が形成されたウエーハ1のこの回路2が形成された側(前面)と、ウエーハ集積回路を構成する機能をもつ回路5が形成されたウエーハ4のこの回路が形成されていない側(背面)とを対向させ、第1具体例と、第2具体例において用いた接続構造を採用して、両ウエーハの回路間を接続することによってウエーハ集積回路が構成されている。

この場合、ウエーハ1とウエーハ4を逆にすることも可能であるが、集積度が高く、歩留りが 格なシステム用回路が形成されてたウエーハに貫 通孔を設けるのは危険であるから、比較的スペース的に余裕があり、より安全なウエーハ集積回路 を構成する機能をもつ回路5が形成されたウエーハ4に貫通孔を設けることが望ましい。

本実施例においては、汎用メモリ等のシステム

ウェーハ集積回路を構成する機能をもつ回路に ついては、チップレイアウトから考えても、余裕 があるから、歩留りを高く保つことが可能で、電 源ラインは必要に応じて幅広くとり、メモリチッ プの電源を制御するパワースイッチの領域も充分 な大きさをとることが可能である。

両ウェーハに形成された回路、例えば、汎用大容量メモリと、プロセッサはウェーハに対して垂 直方向の最短距離で接続されるから、その間の信 号の伝達遅延時間を最小にすることができる。

(2) 第2実施例

第3図(a)、(b)は本発明の第2実施例の 構成図である。

第3図(a)は斜視図、(b)はその断面図で

この図中の符号は、10がプロセッサチップ、 11がバンプである他は第1図、第2図において 説明したものと同じである。

この実施例は、集積回路の性能を重視したもので、システム用回路である汎用メモリ2が形成されたウェーハ1に、配線5が形成されたウェーハ4を積層し、さらに、高速プロセッサチップ10を積層して、それらのウェーハ1、4とチップ10の間を前記の接続構造によって接続することによってウェーハ集積回路が構成されている。

この場合、上記の高速プロセッサチップ 1 0 は 必要に応じてウェーハとして構成することもでき る。

このウエーハ集積回路においては、プロセッサ チップ10内にウエーハ集積回路のネットワーク 用回路を搭載するが、このプロセッサ 1 0 と大容量メモリ 2 は、ウエーハに対して垂直方向にに最短距離で接続されていること、および、プロセッサチップ 1 0 とメモリウエーハ1 の間にある配線用ウエーハ4 はそのウエーハ上に素子を持たないために、ウエーハ基板や配線、層間絶縁膜のパラメータを最適化することが可能である。

また、配線ウエーハ4にはトランジスタなどを 形成しないため、配線のみの工程で済むために、 コスト面でも有利である。

チップレイアウトから考えると配線用回路には 余裕があるから、歩留りを高く保つことが可能で、 電源ラインは必要に応じて幅広くとることができ、 メモリチップの電源を制御するパワースイッチの 領域も充分に大きくすることができる。

上記説明において、ウエーハ1、4について、ウエーハをそのまま完全な形で使用するものとして図示、説明したが、本発明はぞれに限定されることなく、ウエーハの一部を採用してウエーハ集

特閒平4-76946 (5)

積回路を構成する場合も含まれる。

また、前記実施例においては、ウエーハ集積回路を形成するシステムをメモリに限定したが、本発明によれば、例えば、アレイプロセッサ等他の回路でも上記と同様の効果を奏することは明らかである。

(発明の効果)

本発明によると、システム用回路とウェーハ集 積回路の機能を持つ回路を別のウェーハ上に形成 するため、それぞれのウェーハを製造するに際し て、それぞれに最適の製造工程を適用することが できる。

すなわち、システム用回路の、最先端の精緻な 製造工程を用いた大量生産によるコストメリット と、ウエーハ集積回路を構成する機能を有する回 路の、熟成した製造工程を用いることによる高い 歩智りと製造容易性を利用することができる。

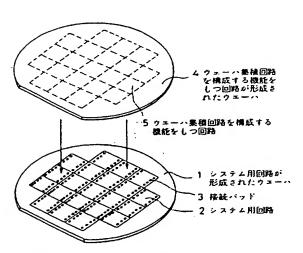
また、これらのウェーハを積層して配置し、その回路の間を最短距離で相互に接続することによって信号の伝播遅延時間を最小に抑えることがで

きる.

4. 図面の簡単な説明

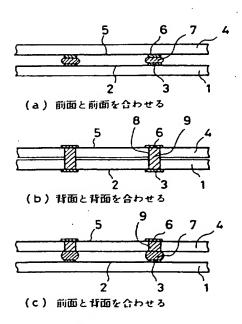
第!図は本発明のウエーハ集積回路装置の第1 実施例の構成図、第2図(a)、(b)、(c) は本発明のウエーハ集積回路装置のウエーハ間の 具体的な接続構造を示す断面図、第3図(a)、 (b)は本発明のウエーハ集積回路装置の第2実 施例の構成図である。

1 ·····システム用回路が形成されたウエーハ、 2 ·····
システム用回路、 3 ····システム用回路の接続パッド、 4 ····ウェーハ集積回路を構成する機能をもつ
回路が形成されたウェーハ、 5 ·····ウェーハ 4 のウェーハ1 に対向する面に形成された、 ウェーハ集積回路を構成する機能をもつ回路の接続パッド、 7 ·····バンプ、 8 ···・貫通孔、 9 ······導体、 1 0 ····プロセッサチップ、 1 1 ·····バンプ



本免明のウェーハ県積回路装置の第1実施例の構成図

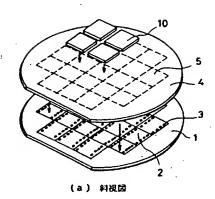
第十図

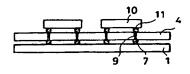


本発明のウェーハ集積回路装置のウェーハ間の 具体的な接続構造を示す断面図

第 2 図

特別平4-76946 (6)





(b) 断面図

本発明のウエーハ集種回路装置の第2実施例の構成図

第3図